解説

アルカリ金属吸着 Si(001)2×1 表面の電子状態

虻川 匡司, 河野 省三

東北大学 科学計測研究所*

Electronic Structures of the Alkali Metal Adsorbed Si(001)2 \times 1 Surfaces

Tadashi ABUKAWA and Shozo KONO

Research Institute for Scientific Measurements, Tohoku University

The study of the electronic structures of single-domain $Si(001)2 \times 1$ -K and Na surfaces at saturation coverage by angle resolved photoelectron spectroscopy with synchrotron radiation has been reviewed. To determine the dispersion of surface states in detail, the spectra were measured along several symmetry axes of the 2×1 Brilluoin zone, and surface-state dispersions were depicted. Symmetry properties of upper surface-state bands were determined using the linearly polarized character of synchrotron radiation. The electronic structures of the $Si(001)2 \times 1$ -K and -Na surfaces determined turned out to be very similar to each other, and the symmetries and dispersions of the surface states suggested that the dangling-bond states play an important role in the formation of surface electronic structure.

1. はじめに

半導体表面には、切れた結合(ダングリングボ ンド)が存在するために、異種原子の吸着や吸着 子配列構造形成のメカニズムは単純ではない。そ の理解のためには、電子状態、特にダングリング ボンドと吸着原子の価電子との相互作用を理解す る必要がある。本稿のテーマであるアルカリ原子 吸着 Si(001)2×1表面は、最も単純な金属吸着半 導体表面であるため、実験的にも理論的にも、深 い理解が期待できる表面の一つである。この系の 基礎的、物理的な理解は、より複雑な系の理解の 糸口になると考えられる。一方、下地の Si(001) 表面は半導体工学的に重要な表面であり、化学的 に活性なアルカリ原子の吸着は様々な性質を引き 起こすことが知られている。そのため、この系は 応用的な面でも注目されている。例えば、Si表面 の酸化におけるアルカリ原子の触媒的な作用が知 られており、盛んに研究が行われている¹⁻⁴⁾。しか し、その基礎的情報である表面構造や電子状態 が、正しく理解されるようになったのは最近のこ とである。

2. アルカリ吸着 Si(001) 表面の研究背景

アルカリ原子吸着 Si (001)表面の電子状態は, いくつかの興味深い問題により早くから注目され ていた。初めに,この表面の研究背景を少し詳し

^{*} 東北大学 科学計測研究所 〒980-77 宮城県仙台市青葉区片平2-1-1 TEL 022-227-6200(内2443) FAX 022-211-9119 e-mail g21006@cctu.cc.tohoku.ac.jp

く説明したい。アルカリ原子が金属表面や半導体 表面に吸着すると、仕事関数が大きく減少するこ とが知られている^{5,6)}。これは、アルカリ原子の電 気陰性度が小さいので、アルカリ原子の価電子が 下地側に移動することにより、仕事関数を減少さ せる向きに電気双極子が生じるためである。仕事 関数は,初めアルカリ原子の被覆率に比例して急 激に減少するが、やがて減少の割合が緩やかにな ることが知られている^{5.6)}。Si(001)表面にCsを吸 着した場合の仕事関数の変化を図1に示すが⁷⁰, 減少の割合が緩やかになった後、途中最小値をと りさらに増加していることがわかる。この増加 は、被覆率の増加と共にアルカリ原子-アルカリ 原子の直接的な結合が生じて、下地側に移ってい た電荷がアルカリ原子に戻ってくることで説明さ れている^{5.6)}。このとき金属表面上にアルカリ原子 が吸着している場合では、被覆率に応じてアルカ リ原子層が絶縁体-金属転移(Mott転移)を起こ すことが知られている⁵。すなわち,金属表面上で 被覆率が低い場合は、アルカリ原子はクーロン反 発力により疎らに吸着するため、価電子がアルカ リ原子に局在した Mott 絶縁体的な電子状態にな り、被覆率が増えてアルカリ原子間の距離が、ア ルカリ金属固体の原子間距離程度になると、絶縁 体-金属転移(Mott転移)により、アルカリ原子 層が金属化すると考えられている。この金属表面 上での絶縁体-金属転移の描像が、ダングリング ボンドを持つ半導体表面上への吸着の場合にもあ てはまるかどうかは、この表面の電子状態の興味 深い問題の一つであった。

Si(001)表面のアルカリ吸着表面の研究とし て、特に注目すべき研究が1973年にGoldstein[®]と Levine[®]によって行われている。Goldsteinは、Cs を飽和吸着させたSi(001)表面が2×1周期を示す ことを観測し、その表面に酸素を適量吸着させる と、さらに仕事関数が減少し、負の電子親和力 (NEA; Negative Electron Affinity)状態が得られ ることを報告している。NEA状態は、バルクSiの 伝導帯の下端よりも真空準位が下がっている状態 を示し、仕事関数の大きさが Si バルクバンドギャ ップ(1.1eV)よりも小さくなると実現する。NEA 状態では、固体中の電子を伝導帯に励起するだけ で真空中に放出されるので,非常に効率が良く, しかも熱幅の小さな電子源となる。Goldsteinの得 た重要なポイントは、NEA表面が2×1周期を示 すことであり、仕事関数の減少が表面の2×1秩序 構造に大きく依存することを発見したことである。 Levine は, Goldstein の実験結果を考察し, NEA 表面の表面周期が清浄表面と同じ2×1周期である ことから、下地の構造として対称ダイマーモデ ル¹⁰ (図2a)を予想した。さらに,酸素吸着によ る仕事関数の減少を説明するために、電気陰性度 の大きな酸素がCsよりも下の位置に吸着すると考 えた。対称ダイマー表面には、Pedestal site(P), Bridge site(B), Valley site(V), Cave site(C)と呼ば れる対称性の高い吸着サイトがあるが、 Levine は、その中でも配位数の大きな Pedestal site と Cave siteに, それぞれ CsとOが吸着している構造

モデル(図2b)を提唱した。さらにLevineは、
NEA表面モデルに基づいて、酸素吸着前のCs飽
和吸着Si(001)2×1表面構造のモデルも図2cの



Fig.1 Changes in work function, Φ , and XPS intensity ratio of Cs3d/Si2p as a function of the duration of Cs deposition on Si(001). Open circle are for Φ and solid circles for the XPS ratio.

様に予想している。このモデルは、NEA表面のモ デルから酸素を取り除いた構造となっている。こ のLevineの構造モデルは、2×1表面周期と仕事 関数の減少を無理なく説明するため、アルカリ金 属飽和吸着 Si(001) 2×1表面の構造として、長い 間受け入れられることになる。このモデルでは、 2×1単位格子中にアルカリ原子が一個吸着してい るので、被覆率は、1/2ML(1ML = 6.8×10¹⁴ atom/cm²; Si(001)表面原子密度)となる。ま た、アルカリ1次元鎖構造とも呼ばれるように、 下地 Si ダイマー列方向に1次元に連なったアルカ リ原子列が特徴である。このモデルのアルカリ1 次元鎖内のアルカリ原子間隔は、下地 Si(001)表



Fig.2 Schematic illustration of surface structural models for alkali metal adsorbed Si(001) surfaces; (a) the symmetric dimer structure of the substrate, (b) the structural model for NEA surface proposed by Levine, (c) the structural model for the Si(001)2×1-alkali-metal surface proposed by Levine, and (d) the double-layer model for the Si(001)2×1-alkali-metal surface. Open circle, shaded circle and solid circle stand for Si, alkali-metal and oxygen atom, respectively. High symmetric absorption sites of the symmetric dimer structure are illustrated in (a). 面の格子定数 ($a_0 = 3.84$ Å) と等しい。この距離 は、バルク Cs 金属での最近接原子間距離よりも小 さいため、1次元鎖内のアルカリ原子間に直接的 な結合が予想できる。このとき金属表面にアルカ リ原子が吸着した場合と同様に、絶縁体 – 金属転 移が生じて1次元鎖が金属化すると考えられて注 目された。例えば、低速電にエネルギー損失分光 (LEELS; LoW-energy Electron Energy Loss Spectroscopy)^{6,11)} や角度分解 LEELS¹²⁾によって表 面プラズモンの研究が行われている。その実験結 果は、Levine モデルのアルカリ原子列を1次元的 な自由電子ロッドで模したモデルによって理論的 にも考察され、1次元的な金属によって説明可能 であることが報告されている^{13,14)}。

一方, Levineモデルを下地Siのダングリングボ ンドとアルカリ原子の結合という視点で考える と、アルカリ原子が1次元鎖内で金属結合を作る ことは、それほど簡単なことではないことが分か る。下地 Siの対称ダイマー表面には、単位格子当 たり2個のダングリングボンドが存在するが, Levineモデルではそれと結合するためのアルカリ原 子の価電子は単位格子当たり1個しかない。した がって、アルカリ原子の価電子が、下地の結合の ために消費されると、1次元鎖内の金属結合のた めの電子が不足する。Levineモデルに対する表面 バンド分散の計算が、石田ら¹⁵⁾、 Ciraciと Batra¹⁶⁾ によって行われたが、アルカリ原子間に純粋な金 属バンドは生じないことが予想された。すなわ ち、アルカリ金属の価電子が下地のダングリング ボンド軌道と強く混成することが理論的に示され ている。この場合も、表面準位の1本は半占有と なり金属的なバンドになることが予想されている が、下地のダングリングボンドとの相互作用によ って生じたバンドであり、アルカリ原子列がいわ ゆる Mott 転移によって金属化したものではな ()^{15, 16)}

その後,遠田ら¹⁷⁻²⁰⁾が表面の電子状態を明らか にするため希ガス共鳴線を使用して角度分解紫外 光電子分光 (ARUPS; Angle-Resolved Ultra-Violet Photoelectron Spectroscopy) を行った。本研究の 手法でもある ARUPS は、表面バンド分散を直接 的に決定できるため,有力な表面電子状態の研究 手法の一つである。遠田らは、 Na¹⁷⁾, K^{18,19)}, Cs²⁰⁾ 飽和吸着 Si(001) 2×1 表面のバンド分散を調べて いるが、いずれの表面にもフェルミ準位を切るバ ンドは存在せず、表面電子状態は半導体的である という予想外の結果を得ている。この結果は、金 属的な表面準位が予想される Levine モデルとは, 根本から矛盾する。この ARUPS の結果を受け て,著者らはこれらの表面の構造をX線光電子回 折^{21,22)}によって調べたが、アルカリ原子が図2d の様に配列していることが分かった。このモデル では、Levineモデルと対応するアルカリ原子列の 間の約1Å低い位置に,もう1列のアルカリ原子が 吸着している。このアルカリ原子が2層に吸着し たモデルの被覆率は、Levine モデルの丁度2倍の 1MLとなる。被覆率 1/2MLの Levine モデルで は、単位格子当たりの価電子は、ダングリングボ ンド2個とアルカリ原子の価電子1個であり、合わ せて奇数個になるために, 金属的な電子状態が予 想された。それに対し,アルカリ原子の数が2倍 の2層吸着モデルでは、表面価電子の数が偶数個



Fig.3 Comparison of the surface-state dispersion between experimental one and theoretical one for the surface of Si(001)2×1-K (from-ref. 28).

になるため、半導体的な電子状態が期待できる。 既に、2層吸着モデルに対する表面バンド分散の 理論計算²³⁻²⁷⁾が行われている。結果は、何れも半 導体的な電子状態を結論しており、 ARUPS の実 験結果と一致している。この2層吸着モデルに対 するバンド分散の計算結果²³⁾を遠田らのARUPS 実験と比較したものが図3である28)。実験と計算 は、2本の完全に占有された表面バンドという点 は一致しており、電子状態は2層吸着モデルで理 解可能であると考えられる。最近, Johansson と Reihlが角度分解逆光電子分光を行ってシングルド メイン2×1-K²⁹⁾,-Na表面³⁰⁾の電子状態の研究 を行っている。角度分解逆光電子分光は、光電子 分光の逆過程を利用して非占有電子状態のバンド 分散を得る手法で, ARUPS とは相補的な実験手 法である。彼らは,非占有電子状態も2層吸着モ デルに基づく理論計算と定性的に一致することを 示している。しかし、図3の理論とARUPSによる 実験の比較では、必ずしも満足な対応が得られて いるわけではない。また、 ARUPS 実験では Γ -J とΓ-J'軸方向の分散しか調べられていないが,理 論計算と比較して電子状態をより深く理解するた めには、より多くの対称軸に対する分散を調べる

必要がある。本稿では,それらの問題を解決する ために,放射光の特徴を駆使したARUPSにより アルカリ金属吸着Si(001)2×1表面の電子状態を 詳細に調べた結果について紹介する。

3. 放射光を使用した ARUPS

図4に、角度分解光電子分光法(ARUPS)の模 式図を示す。ARUPSでは、放出された光電子の運 動エネルギー E_{μ} と波数ベクトルk'を同時に測定す ることによって、光電子の始状態の結合エネル ギー E_{B} と波数ベクトルの表面平行成分 k_{II} を、知 ることができる。ARUPSの励起光源としては、希 ガス放電管による He-I共鳴線が一般的であるが、 優れた特徴を持つ放射光を光源とすると様々なこ とが可能になる。波長を自由に変えられること が、放射光の特性の一つであるが、それによって ARUPSでは、kzも任意に指定して測定すること が可能になる。また、光電子の励起断面積の波長 依存性を利用した研究を行うことができる。本研 究では、観測されたバンドがk」方向にも分散を持 つバルクの準位なのか、2次元的な表面準位なの かを区別するために複数の波長の励起光を使用し て分散を測定している。放射光の一般的な特長と して、強度が強いことと光学系によってビームが 絞られていることも挙げられる。ARUPSによって 表面バンド分散を求めるためには, 表面ブリルア ンゾーン (SBZ; Surface Brillouin Zone) の目的の 領域を走査するように数多くの位置で光電子スペ クトルを測定しなければならない。SBZのどれだ け多くの領域を、どれだけの密度で調べられるか は、励起光源の強度に大きく関係してくる。ま た、小さなビーム径は光電子を取り込む角度分解 能を向上させるので, 波数空間での分解能が向上 する。したがって、強度の強さと小さなビーム径 は、波数空間内を高密度で調べることを可能に し、詳細で信頼性の高いバンド分散決定に大きく 貢献する。

放射光のもう一つの特長は、偏光である。偏向 電磁石から取り出される放射光は、一般に直線偏 光になる。この直線偏光性を使用して表面準位の 鏡映面に関する空間対称性を調べることができる。 その原理の詳細は光電子分光の教科書³¹⁾を参考に していただくことにして、ここでは測定の方法の 概略についてのみ述べることにする。いま、試料 表面に鏡映対称性が存在し、その鏡映面内に光電 子を観測する場合を考える。例えば、図4におい て、紙面が鏡映面に一致すると考えていただきた い。この場合、観測の対象となる電子状態は鏡映 対称性を満たすことになり, 鏡映操作に対して偶 または奇の対称性を持つことになる³²⁾。このと き, 励起光の偏光ベクトルを鏡映面(紙面)に平 行して光電子を観測する場合をA』垂直にして観測 する場合をA」と表すことにすると、A』の場合は





Fig.4 Schematic illustration of angle-resolved photoemission.

奇対称性を持つ始状態からの遷移が禁制となり, 逆に, A₁の場合は偶対称性を持つものからの遷移 が禁制となる³³⁾。この性質を利用して励起光の偏 光ベクトル, すなわち直線偏光の向きに依存した 測定を行うと始状態の偶・奇対称性を明確に求め ることができる。この対称性は, その表面電子準 位の起源を考えるうえで大きな手がかりとなり, バンド分散と共に重要な情報である。

4. 実験

4.1 実験装置

実験は、高エネルギー物理学研究所放射光実験 施設のビームラインBL-18A で行ったものであ る。このBL-18Aは、角度分解光電子分光を中心 とした表面などの電子状態の研究を目的に、東京 大学物性研究所が建設したビームラインである³⁴⁾。 斜入射定偏角型分光器により、10~150eVの単色 化された放射光を励起光源として使用できる。さ らに、その分光器の後ろには Vacuum Generators 社製の ADES500 光電子分光装置が設置されてい る。μメタル製の超高真空槽内に,静電半球型の 角度分解電子エネルギー分析器が備わっており, 試料を中心に2軸回転が可能になっている。その 他にも、X線管、希ガス放電管、角度積分型の電 子エネルギー分析器,背面 LEED 光学系などが備 わっており、表面の組成分析や表面の周期性の確 認がその場で行えるようになっている。試料マニ ピュレーターは、3方向並進と2軸の回転を可能な ものを使用した。本研究では, さらにアルカリ原 子の蒸着源(サエスゲッター社製のアルカリ金属 ディスペンサー)とSiの蒸着源を真空槽に装着し た。Siの蒸着源は,短冊型(3×20×0.5mm³)に 切り出したSiウェハーを,通電加熱(1200℃)し て昇華させるタイプを使用した。

4.2 試料の準備

通常 Si (001) 表面は, 方位の異なった2 種類の 分域が均等に混在したダブルドメイン構造をとる という非常に厄介な性質を持つ。ダブルドメイン 表面を使用して ARUPS を行った場合, 観測され たバンド分散がどちらの分域のものなのか判別で きないために実験結果の解釈が非常に曖昧になる。 それに対して、一方のドメインを優勢に成長させ る手法が幾つか報告されている35-39)。本研究で は、その中でも最も理想的な坂本らの手法を使用 してシングルドメイン表面を作成して下地として 用いた。使用したSi(001)基板は、この手法の開 発者である電総研の坂本統徳博士、坂本邦博博士 のご好意によって提供して頂いたものであり、真 の(001)軸からの面の傾きが[110]方向に~0.05°, それに垂直な方向に~0.01°しか傾いていない非常 に精度の高いものである。その傾斜から計算され る単原子層ステップの間隔、つまり平均のテラス の幅は~1600Åであり、非常に広いテラスが予想 される。Si(001)基板は,長軸が[010]方向の短 冊状 (25×3.5×0.38mm³) に切り出し, 坂本らと 同じ処方箋³⁸⁾にしたがって脱脂,エッチング,酸 化保護膜の作成を行った後にマニピュレーターに 装着した。

試料を装着した実験槽を超高真空に排気した 後、坂本らが開発した手法³⁸⁾ にしたがってシング ル・ドメイン作成を行った。それは、充分に清浄 化した Si (001)表面に Si バッファー層を成長さ せ、直流電流による通電加熱を行うというもので ある。この行程により最終的に、優勢ドメインと 劣勢ドメインの比率が7~10対1程度の清浄なシ ングルドメイン Si(001) 2×1表面を得ることが出 来た。完全なシングル・ドメインではないが,一 方のドメインの寄与を区別する目的のためには充 分な比率である。以上のようにして準備した清浄 な Si(001)シングルドメイン表面に,アルカリ金 属(Na,K)を飽和吸着させて,目的のアルカリ 金属飽和吸着 Si(001) 2×1表面を作成した。蒸着 時の下地の温度は,室温程度である。アルカリ金 属蒸着後の表面を XPSで調べたが,アルカリ原子 以外の不純物は,検出されなかった。同じ真空槽 で測定したものではないが,シングルドメインNa 飽和吸着 Si(001) 2×1表面の LEEDパターンを図 5に示す。ダブルドメインでは,パターンは4回対 称性を示すが,図5はシングルドメインなので,2 回対称性を示している。

4.3 ARUPSの測定条件

図**6**にアルカリ金属吸着 Si(001) 2×1表面の表 面ブリルアン域(SBZ; Surface Brillouin Zone)を 周期的ゾーン形式で示す。本研究の測定に関係す る領域およびその対称点を示してある。図**7**は、2



Fig.5 LEED pattern of a single-domain Si(001)2× 1-Na surface. The energy of the primary electron beam is 50eV.

× 1SBZの対称軸に対するバルクバンドの投影を 示す。表面逆格子ベクトルにウムクラップ (Umklapp) 散乱を考えない場合の第2SBZ(Γ₂-J₁ -K₁-J'₂₂-Γ₂)に対する投影も示してある。第 1SBZに比べ第2SBZの方がバルクバンドギャップ が広く開いていることが分かる。一般に,表面逆 格子によるバルクバンドのウムクラップ散乱は小 さいので,バルクバンドギャップが広く開いてい る第2SBZの方が表面準位を観測しやすい。その ため本研究では,第2SBZに重点を置いてバンド



Fig.6 The surface Brillouin zone of the single-domain Si(001)2×1-alkali surface in the repeated zone scheme. Symmetry points relevant to the present study are indicated.

分散の測定を行っている。

直線偏光した放射光を使った場合,表面に対す る電子の放出方向と励起光の入射方向に加えて, 偏光の向きもパラメーターになるため測定時の幾 何学的配置が,重要になる。特に,放射光の直線 偏光は,偏光電磁石によって決まってしまうた め,偏光依存実験を行うためには,試料と電子分 光器の側を回転しなければならなくなる。図8a, bに,本研究で用いた測定系の幾何学的配置の模 式図を示す。図中の大きな半球が2軸回転可能な 角度分解型電子分光器が走査できる範囲であり, 試料はその球の中心Sに位置している。試料マニ ピュレーターは半球の上面に垂直な軸に対する回 転 θ とそれに垂直な軸に対する回転 ϕ が可能であ



Fig.7 Projected bulk bands of the Si(001)2 \times 1 surface.



Fig.8 Schematic view of experimental geometries for ARUPS using polarized light, (a) at the normal incidence and (b) at θ_i of a finite incidence angle.

り、試料はその法線がマニュピュレーターの方位 このマニピュレーターと検出器の回転軸の配置 は、放射光を使用して角度分解光電子分光を行う 装置では、一般的なものである。図中のΓは、表 面の法線が半球と交わる点を示しており、検出器 をΓに置くと丁度 SBZのΓ点を測定することにな る。放射光は、半球の断面に並行に入射してお り, 偏光ベクトルもその断面に平行である。図8a とbの違いは、試料に対する放射光の入射角であ る。aは垂直入射の場合であり、bは入射角 θ_i (\neq 0)の場合である。偏光依存実験におけるA_#モー ドは、図8a, bのどちらでも半球の上面に試料の 鏡映面を一致させて検出器をΓからPの方向に走 査すると実現できる。A₁モードは, 垂直入射の条 件(図8a)で, SとΓと半球の底Oの3点を含む 面が鏡映面になるように試料の方位角を回転し て,検出器を Γ から 0 の方向に走査すればよい。 K 吸着 Si(001) 2×1 表面に対する偏光依存 ARUPS実験はこのA_#とA₁モードを使用した。と ころがこの配置では、Γ点付近を測定しようとす ると検出器が入射光を遮ってしまう。使用した検 出器では、A₁モードの場合に 57° 以上しか測定で きなかったため SBZ 内の限られた範囲しか測定で きなかった。そこで、Na吸着Si(001)2×1表面 の実験では、検出器が光を遮らないように入射角 を大きくして図8bの様な配置で測定を行った。 具体的には、入射角 $\theta_1 = 28.5^{\circ}$ とすることで検出 器を避けて放射光を入射することができた。この 場合も図8aでのA₁モードの場合と同様に, 鏡映 而をS. Γ , Oを含む面に設定して検出器を Γ か ら〇方向に走査する。ただし、入射光の偏光ベク トルは鏡映面に対して垂直ではなく、垂直な成分 と平行な成分を同時に持つ。この測定モードをA" + A₁モードと呼ぶことにすると, A₁ + A₁モード では、 奇対称性を持つ準位だけでなく、 偶対称性 を持つものも同時に観測されることになる。Na吸 着 Si(001) 2×1 表面における偏光依存 ARUPS

は, A_# + A₁モードで測定したスペクトルとA_# モードで測定したスペクトルを比較することで行った。

偏光実験以外の分散の測定は、両吸着表面共 に、入射角 $\theta_i = 45^\circ$ で図8bの A_x モードの配置で 測定を行った。電子を検出する極角方向の走査 は、検出器を Γ からP方向に走査することで行 い、方位角方向の走査は、試料マニピュレーター の方位角を回転することで行った。

5. 実験結果

5.1 K/Si(001)2×1表面の実験結果

k/Si(001)2×1表面のバンド分散の測定は,主 としてhv = 22eVの放射光を使用して行った。図 9aは、シングルドメインSi(001)2×1-K表面で 得られたΓ-J方向の ARUPS スペクトルの一部で あり、 Γ_2 付近 ($\theta_e = 23^\circ$)から J₂付近 ($\theta_e = 33^\circ$) に対応するスペクトルである"。ただし, θ。は表 面法線から測った電子の検出角度である。横軸は フェルミ準位を基準とした結合エネルギー、縦軸 は光電子強度である。この方向は、鏡映面に一致 するため、偏光による選択則が働き、偶の状態し か観測できない。 Γ₂ 点に対応するスペクトルに は、明確な2本のピークが観測されている。この ピークは、既に遠田らが報告している S₁準位と S₂ 準位に対応する^{18,19}。S₁とS₂は、J点にかけて互い に近付くように分散し、J点では重なると考えら れれいた。ところが、極角を細かく(0.5°~1°間 |隔) 走査して分散を調べた結果, J点で S」と重なる のは、 S_2 ではないことが分かった。**図9a**で S_2 の 分散を Γ_2 点から J_2 点側へ追いかけて行くと、中間 付近の $\theta_{e} = 28^{\circ} \sigma S_{1} \ge S_{2} l' - \rho \sigma l c 新たな l' -$ クSi'が現れていることが分かる。Si'は、J2点に 向かってS₁と近づくように分散し, J₂点でS₁と重 なっている。このように、波数空間を高密度で走 査することによって、新たな構造を見い出すこと ができた。図9aには、27°から30°まで、1°間 隔でそすていしたスペクトルを示しているが、1°



Fig.9 ARUPS spectra for K/Si(001)2×1 surface along (a) Γ_2 -J₂, (b) Γ_2 -J'₂₂ and (c) J₁-K₁ line of SBZ, measured at hv=22eV and A, with θ_i =45°(from ref. 7).

の違いでスペクトルの様子が大きく変化している ことがわかる。一方、 S_2 は Γ_2 点から J_2 点に向か うに従って強度が弱くなり、 Γ_2 - J_2 の中間付近 (θ_{\circ} = 29°)で観測できなくなっている。そのため 残念ながら S_2 についてはJ点付近の分散は、確認 できなかった。

図9b, cは, それぞれSBZの Γ_2 -J'₂₂, J₁-K₁ 対称軸に対応するスペクトルである。一つ一つの スペクトルの対称軸上の位置をそれぞれ Γ_2 , J₁か らの距離(Å⁻¹)で示してある。これらの対称軸上 の走査は, E_B = 1.5eVの電子状態の波数ベクトル がその対称軸にのるように, 方位角と極角を両方 変えて行っている。したがって, E_Bが1.5eVから 大きく離れた電子状態は, やや対称軸から外れて いる。図9b, cでは, 一般に電子を取り出す方向 が鏡映面内でではないので対称性に関する選択則 は働かない。

 Γ_2 -J'₂₂軸に関するARUPSスペクトル(図**9b**) には、やはりS₁とS₂の間にS₂'に対応するピーク が観測された。S₁'ピークは、 Γ_2 -J'₂₂の中間付近 (k_x = 0.37Å⁻¹)で現れ、J'₂₂点でS₁と一緒になっ ている。また、S₂に対応するピークはやはり Γ_2 - J'_{22} の中間付近で消失しているので、 Γ 点近傍以外 の分散ははっきりしなかった。 $J_1 - K_1$ 方向と $J'_1 - K_1$ $-J'_{22}$ 方向は、これまで測定されていない方向であ る。 $J_1 - K_1$ 方向(図**9**c)では途中 $S_1 \ge S_1$ が分離し ていることが分かる。スペクトルは示さないが、 $J'_1 - K_1 - J'_{22}$ 方向では、 $S_1 \ge S_1$ が分離せず常に1本 のピークとして観測された。

以上の様にして多数測定した ARUPS スペクト ルから描いた Γ_2 -J₁-K₁-J'₂₂ Γ_2 に対するバンド分 散が図 10 である。スペクトル中に観測されたピー クの位置 (E_B) に波数ベクトルの表面平行成分 (k_s) に対してプロットしたものである。図には、第 2SBZ に対するバルクバンド投影⁴⁰⁾ も示してある。 ただし、バルクバンド投影のエネルギー位置は、 粗く見積もったものであり多少の不定性を持つ。 Γ_2 付近、E_B~0.2eV に観測されている状態 Eは、 2×1表面の本質的なものでは無いことが、遠田ら の ARUPS¹⁸⁾ や Johansson らによる逆光電子分光²⁰⁾ の結果から予想されている。したがって、本来の 2×1表面は、S₁の上にバンドギャップが開いた、 半導体的な電子状態になっていることが結論され る。



Fig.10 E₈ versus k diagram along Γ_2 -J₁-K₁-J₂₂- Γ_2 of the SBZ (cf. fig. 6) obtained from the ARUPS spectra in fig.9 and others not shown. Solid symbols are the results with hv=22eV excitation. Circle stand for strong or clear peaks and triangles for weak or broad structures in actual spectra. Open circles and open triangles are the results with hv=28eV excitation and open rectangles stand for the results with hv=35eV excitation. An extrinsic state, E, and the surface states, S₁, S₁ and S₂ are labeled.

図10にはS」準位とS」準位の分散が明確に描き 出されている。ただしΓ₂点付近では, S[']ピーク がS₁ピークのすそに埋もれてしまうため、S₁'の分 散がはっきりしなかった。一方 S₂準位は, Γ₂点付 近の分散しか得られなかったが、この E_B vs.k_xプ ロットから, S₁'とS₂が異なったバンドであること がはっきりと分かる。得られたバンドのk₁依存性 を調べるために、hv = 28eV, 35eVの励起光を 使用して同様の測定を行った。その結果も図10に 示してあるが、結合エネルギーのかなり深い領域 にまでk₄依存性のない, つまり表面準位, 表面共 鳴と考えられるバンドがあることが分かる。ただ し,深い領域 $(E_B > 2eV)$ の表面バンドは表面の ダングリングボンドや吸着したK原子の価電子に 直接完成するものではないと考えられるため深く 考察しない。

次に偏光依存 ARUPS 実験について述べる。下 地 Si(001)対称ダイマー構造は、C_{2V}対称性を持

つ。すなわちダイマーボンドの中央を通る表面法 線軸に関する2回対称性を持ち,法線とダイマー 列方向(Γ-J'軸方向)で張られる鏡映面と,法線 とダイマー列に垂直な方向(Γ -J軸方向)で張ら れる鏡映面を持つ(図2a参照)。2つの鏡映面の前 者を, Γ-J'鏡映面, 後者をΓ-J鏡映面と呼ぶこ とにする。一般にアルカリ飽和吸着2×1表面も同 じ対称性を持つことは、ほぼ一致した見解であ り、Levineモデル、DLモデルともに同じ対称性 を持つので, 偏光依存実験は, このΓ-J'鏡映面と **Γ-J**鏡映面に対して行った。図11に, 偏光依存 ARUPSスペクトルの例を示す。縦軸は強度の比較 が行えるように光の強度、測定時間で規格化した 相対的な強度である。図11a, bはΓ-J鏡映面に 対する偏光依存スペクトルであり、それぞれ垂直 入射条件の A "モードと A ュモードで 測定した結果 である。光電子の取り出し方向は、いずれもθ。= 58°で, SBZのJ₃点とΓ₄点のほぼ中間の位置に対 応する。基本的に図11 aでは Γ-J 鏡映面に対して 偶対称性を持つ状態,図11bでは奇対称性を持つ 状態のみが観測される。ただし、スペクトル中 で、pで示した比較的弱いピークは、励起光の直 線偏光度の不完全性によるA_#励起の混入で説明さ れる構造である。また、mはシングル・ドメイン の劣勢ドメインの寄与, すなわちΓ-J方向のスペ クトルでは, Γ-J'方向のスペクトルの混入による ものである。したがって、p,mで示される構造 は本質的なものではない。また、ピーク Eは、先 ほど示したように余分な K 原子によるもので、や はり本質的なものではない。他にも多数測定した Γ-J 鏡映面に対する偏光依存スペクトルを用いて 描いた Γ_3 -J₃- Γ_4 に関する分散を図 12 a に示す。 ●,▲は、それぞれA_#で測定したスペクトルの強 いピークと弱い構造を表す。○, △は, А」で測定 されたピークと弱い構造である。この分散を図10 の分散と比較するとS」とS」で強く観 測されていることが分かる。一方、A.でもS.に対 応する位置に弱い構造が観測されているが、これ



Fig.11 Polarization-dependent ARUPS spectra for a single-domain Si(001)2×1-K surface recorded with hv=28eV, $\theta_i=0^{\circ}$ and $\theta_e=58^{\circ}$. The spectrum (a) is the one in Γ -J direction with A_x geometry, (b) in Γ -J direction with A_⊥, (C) in Γ -J direction with A_⊥, (d) in Γ -J' direction with A_⊥. Surface states, S₁ and S₁', are labeled. The labels m and p indicate, respectively, admixtures of the minor domain contribution and the opposite polarization due to an imperfection of polarizability of the synchrotron radiation. The peak E in (a) is an extrinsic state. The ordinate is relative photoelectron intensity as normalized to the incident intensity. Note the scale-change in (b). (from ref.7).

は直線偏光度の不完全性によりA₄成分が混入した ものと考えられる。したがってS₁とS₁は両方とも Γ -J鏡映面に対し偶対称性を持つ状態であること が結論できる。また Γ_4 点付近E_B~1.6eVに観測さ れるS₂も偶対称性を持つことが分かる。A₄でJ₃点 付近E_B~1.6eV, Γ_4 点付近E_B~1.2eVに弱いなが らもはっきりした構造が観測されているが,他の 実験分散と対応がつかなかった。おそらくバルク バンドの直接遷移が見えているのであろう。

図11 c, dは Γ -J'鏡映面に対する偏光依存スペ クトルである。光電子を Γ -J'鏡映面内, θ_{e} = 58° 方向に取り出したもので、Γ2点とJ2点の中間の 状態に対応する。図12bが、Γ-J'鏡映面に対す る偏光依存スペクトルを用いて描いた Γ₂-J'2 に関 する分散である。Γ2点とJ2点の中間からJ2にか けてE_B~0.8eV に観測される弱い構造は、劣勢ド メイン, すなわち Γ-J 方向の混入に因るものであ る。この分散を図10の分散と比較すると、S」は A₁でのみ観測され, S₁'はA₂でのみ観測されてい ることが分かる。つまりS₁はΓ-J'鏡映面に対し 奇対称性を持つ状態で、Si'は偶対称性を持つ状態 であることが結論される。また, Γ2点から少し離 れたところの E_B~1.5eV に S₂が観測されているが 偶対称性を示している。以上得られた結果を,準 位ごとにまとめると、S₁は、Γ-J鏡映面に対して 偶, Γ-J'鏡映面に対して奇対称性を持ち, S_i'お よび S₂は、両方の鏡映面に対し偶対称を持つこと が分かった。

5.2 Na/Si(001)2×1表面の実験結果

図13a, b, cにNa/Si(001)2×1表面で得ら れた ARUPS スペクトルの一部を示す。hu = 21.2eVの放射光を使用し, A_x, θ_i = 45°の条件 で測定した結果である。図13 aの, Γ2点に対応す るスペクトル ($\theta_{e} = 22^{\circ}$)には、遠田ら¹⁷⁾ が報告 しているように表面準位 S₁と S₂が観測されてい る。ただし、Γ₂点からJ₂点方向にその分散を追い かけていくと, 2×1-K表面の場合と同様に, S₁ と S2の間に S1'が現れることが分かる。これらのス ペクトル及びその他のスペクトルから描いた分散 $(\Gamma_2 - J_2, J_1 - K_1 - J_{22} - \Gamma_2)$ を図14に示す。hv = 21.2eVの結果と同時にhv = 25eVで励起した ARUPSによる結果も示してある。得られた S₁, S₁, S_2 の分散は、それぞれ図 10の2×1-K表面の S_1 、 S₁, S₂の分散と良く似ていることが分かる。大き な違いは、2×1-Na表面の表面準位の方が2×1 -K表面のものよりも全体的に結合エネルギーの深



Fig.12 E₈ versus k, diagrams resulting from the polarization dependent ARUPS spectra in fig.11 and other not shown, (a) for $\Gamma_3 ext{-}J_3 ext{-}\Gamma_4$ and (b) for $\Gamma_2 ext{-}J'_2$ of SBZ (cf. fig6). Solid symbols are plotted from results with A, geometry and open symbols from results with A_⊥ geometry; measurements with A_⊥ for k_x < 1.9 Å⁻¹ were not carried out.



Fig.13 ARUPS spectra for Na/Si(001)2 \times 1 surface along (a) Γ_2 -J₂, (b) Γ_2 -J'₂₂ and (c) J₁-K₁ line of SBZ, measured at hv=21.2eV and A₂ with θ_1 =45° (from ref.7).



Fig.14 E_B versus k, diagram for Na/Si(001)2×1 surface along Γ_2 -J₂, J₁-K₁-J₂₂- Γ_2 of the SBZ (cf. fig.6) obtained from the ARUPS spectra in fig.13 and others not shown. Solid symbols are the results with excitation hv=21.2eV. Open symbols are those with excitation hv=25eV. Circles and triangles stand for the same as in fig.10.

い側にあることである。

2×1-Na表面に対する偏光依存 ARUPS スペク トルの例を図15に示す。図15aは、Γ-J鏡映面に 対する偏光依存スペクトルで、 A "とA "+ A ュモー ドで測定したものを比較してある。A_#スペクトル とA_#+A₁スペクトルの縦軸は、偶対称性を持つ 準位のピークで揃えてある。両方のモードで観測 されるのが偶対称性を持つ準位で、 A_# + A₁モー ドでのみ観測される準位が奇対称性を持つ準位と なる。 Γ -J方向のスペクトルを比較すると、 $E_B <$ 2eVの領域でA_wとA_w+A_xでほぼ同じスペクトル が得られていることがわかる。すなわち奇対称性 を持つ準位が存在しないことが分かる。それに対 しΓ-J'方向では、A_#モードでは観測されていな いS₁が, A₁+A₁モードではっきりと観測されて いる。このことは、 S_1 が Γ -J'鏡映面に対して奇 対称性を持つことを示している。Γ-J方向, Γ-J' 方向ともに多数の点で測定を行った偏光依存 ARPESスペクトルから描いた分散を図16a, bに 示す。●,▲は,偶対称性を持つ状態を示し,○,



Fig.15 Polarization-dependent ARUPS spectra for a single-domain Na/Si(001)2×1 surface recorded with hv=21.2eV, at $\theta_e=16^\circ$, (a) in the Γ -J direction and (b) in the Γ -J direction, Spectra recorded with A, and A_⊥ + A, geometry are plotted with solid lines and dots, respectively. Surface states S₁ and S₁' are labeled on the spectra. The label m indicates admixture of the minor domain contribution. (from ref.7).

△は、奇対称性を持つ状態を示す。 $\Gamma_1 - J_1 - \Gamma_2$ 方向 の分散に対応する図16 a では、表面バンドの分散 は部分的にしか現れていないが、図14の分散と比 較することにより、S₁、S₁、S₂に対応させるこ とができる。図16 a からS₁、S₁、S₂に対応させるこ とができる。図16 a からS₁、S₁、S₂は全て Γ -J 鏡映面に対して偶対称性を持つことが分かる。図 16 b は、 Γ -J'鏡映面に対する偏光依存スペクトル から描いた分散である。 Γ -J'鏡映面に対しては、 結合エネルギーにして約1eVから1.5eVにかけて 奇対称性を示すバンドが現れている。この分散を 図14の Γ_2 -J'22の分散と比較することにより、こ のバンドがS₁であることは明らかである。S₁'とS₂ については、偶対称性であることが解る。得られ た対称性は、2×1-K表面のものと一致している。



Fig.16 E_B versus k_s diagrams resulting from the polarization dependent ARUPS spectra in fig.15 and others not shown, (a) for Γ_1 -J₁- Γ_2 and (b) for Γ_1 -J'₁ of SBZ (cf. fig.6). Solid symbols and open symbols, respectively, stand for the state with even symmetry and with odd symmetry.

6. 結果の考察

6.1 表面準位の起源

アルカリ吸着 Si(001) 2×1 表面の表面準位に直 接関わる電子は、アルカリ原子の価電子と清浄表 面でダングリングボンドを形成していた電子と考 えることができる。初期に考えられていたよう に, アルカリ原子間に自由電子的な金属結合が生 じているとしたら、そのバンド分散はある程度予 測できる。アルカリ原子は1価なので、Γ点に底 を持つsバンド的な分散が生じるであろう。さら に、その結合が Γ -J'方向に1次元的なものなら ば、 Γ -J'方向にのみsバンド的な分散を持ち、 Γ -J方向には分散の小さなバンドが予想できる。既 に報告されているARUPS 結果17-20) と同様に、本 研究では、そのような分散を示す表面準位は観測 されていない。この結果は、Si(001)表面上のア ルカリ原子の吸着が金属表面への吸着とは異なっ た機構に支配されていることを示す。観測された 表面準位 $S_1 \geq S_1$ の大まかな特徴は、 Γ 点付近にバ





Fig.17 Schematic illustration of, (a) anti-bonding orbital, π^* , and (b) bonding orbital, π , of the dangling-bond states of the symmetric dimer substrate.

ンドの頂上があり, Γ点から離れるにつれてエネ ルギーが下がっていることである。この特徴は, 清浄 Si(001) 2×1表面で観測されるダングリング ボンドに由来する表面準位のものと一致する⁴⁰⁰。 この分散の傾向から,表面の電子状態に対してダ ングリングボンドが大きな役割を果たしているこ とが予想できる。

一方,偏光依存 ARUPSの結果,S₁,S₁,S₂の 対称性を明らかにすることができた。中でもS₁ は, Γ -J'鏡映面に対して奇対称性を持つことが分 かった。このことは,下地としてSi対称ダイマー 構造を仮定した場合, Γ -J'軸上で表面準位S₁の 波動関数がSiダイマーボンドの中間に節を持って いることを示す。図17に示すように,対称ダイ マー表面のダングリングボンドは,ダイマー原子 からほぼ垂直に突き出たsp³軌道であり,2×1単 位格子中に2本存在する。強結合近似の描像で は,この2本のダングリングボンドは,それぞれ 図17のaとbに示すように,反結合軌道(π)と 結合軌道(π)を作っていると考えられる。それ ぞれの軌道の対称性に注目すると, π *軌道はダイ マーボンド中間に節を持っており, Γ-J'鏡映面に 対し奇対称性を持つことが分かる。このπ*軌道の 対称性は、最もエネルギーの高い表面準位S₁の対 称性に一致する。一方, π 軌道は Γ -J, Γ -J'両 方の鏡映面に対し偶対称であり、S₁'に対して得ら れた対称性と一致する。したがって、実験で得ら れた分散と対称性の結果から、S1とS1が、それぞ れπ*およびπに起源を持つ表面準位であることが 推測できる。既にアルカリ吸着 Si(001) 2×1表面 のバンド計算は、Levineモデル、2層吸着モデル に対して多くの研究者²³⁻²⁷⁾によって行われてお り, ダングリングボンド準位 π*, πに起因する表 面準位が現れることについては, 一致した見解が 得られている。石田ら23)は、表面準位の電荷密度 分布も計算しているが, π*に起因する表面準位が ダイマーボンドの中間に節を持つことを示してい る。したがって、ARUPSの結果から予想される 表面準位の起源は,理論研究からも裏付けられて いる。

6.2 表面準位の分散と構造モデルの検討

π*およびπに起因すると思われる2本の表面準 位のS₁とS₁'は、完全に占有されたバンドとして観 測されている。すなわち、2本のバンドは2×1単 位格子当たり4個の価電子によって満たされてい る。下地の対称ダイマー構造におけるSiのダング リングボンド電子の数は、2×1単位格子あたり2 個であるので、アルカリ原子層が、2×1単位格子 当たり2個の価電子を供給していることがわかる。 前述したように、アルカリ原子が単位格子当たり 2個の価電子を供給するためにはアルカリ原子の被 覆率は1MLでなければならない。1/2MLでは, 2つのバンドを満たすことはできない。実際に理論 計算でも、被覆率1MLの2層吸着モデルでは、そ の2本の表面準位は完全に満たされて半導体的な 電子状態になることが示されており、被覆率1/ 2MLのLevine モデルに対する計算では, π^* に起 因する表面準位が半分だけ占有された金属的な電 子状態が予想されている²³⁻²⁷⁾。背景でも述べたよ うに, Na, K, Cs吸着 Si (001) 2 × 1 表面の Γ-J, Γ-J'軸に関する表面準位の分散は、遠田らに よって既に調べられており17-20), 2層吸着モデル に対する理論計算との比較も行われている。しか しながら、理論と実験に充分な一致は得られてい なかった。その原因は、実験的な情報不足と理論 計算の精度的な問題であると考えられていた。今 回, Si'を見い出したことで以前のバンドの解釈が 大きく変更された。さらにΓ-J, Γ-J'軸の他に もJ-K軸, K-J'軸についても分散を調べてたの で、これまで以上に詳細に理論計算による分散と 比較できる。一方で、理論研究も進展し、構造の 最適化を含む第一原理計算も幾つか行われてい る26.27)。その中でも、得られた最適化構造が実験 事実と良く一致している小林ら27 の計算結果と本 研究の実験分散を比較する。彼らの理論計算の特 徴は、アルカリ原子や下地 Si 原子の殆ど全ての座 標を第一原理分子動力学計算を用いて最適化して いることと, s電子を価電子として持つアルカリ 原子に関しても信頼できる結果が得られるよう に、内殻電子の効果を部分的に補正していること である。彼らの得た最適化構造は、アルカリ原子 が Pedestal site と Valley site に吸着した 2 層吸着構 造である。また、以前のバンド計算ではバルク Si 原子間距離 (2.35Å) 程度と仮定されていた下地の Siダイマー原子間の距離が、最適化構造で~10% 程度広がっていることを見いだしている。そのこ とによってπ*とπに起因する2本の表面準位の分 裂の幅が、それ以前の計算よりも狭くなっている のが、彼らの得たバンド分散の特徴である。

図18に本研究で得られたK吸着Si(001)2×1 表面の表面準位の分散と小林らのバンド計算²⁷⁾と の比較を示す。ハーフトーンの帯が本研究の実験 結果であり、計算は実線で示してある。実験と計 算の分散が最も一致するように、実験のフェルミ 準位を、計算のフェルミ準位(バンドギャップの 中央)に対し0.6eV低結合エネルギー側にシフト



Fig.18 Comparison of the experimental surface-state dispersion (shaded bands) for the K/Si(001) 2×1 surface deduced from figs.10 and 12 with that (solid lines) of the theoretical calculation²⁷⁾ based on an optimized double-layer model (from ref.41).

してある。この食い違いは、実験では光電子励起 時に生じるホールの影響でギャップの大きさが実 際よりも開いているように観測されているためと 考えられている。彼らの計算は、基本的に repeating slabを用いた擬ポテンシャル法によるものであ る。バンド計算では、slabの表と浦の表面準位が 相互作用によって分裂しているため、近接した2 本のバンドを1本のバンドと考えて実験と比較を しなければならない。理論計算において、バルク バンドギャップ中に現れている2本のバンドは、

π*とπに起因する表面準位である。実験と理論計
算の分散を比較すると、S₁とS₁バンドがそれぞれ
π*とπに起因する表面準位に良く対応していることがわかる。Γ点付近で、S₁と計算の分散の対応が明確でないのは、バルクバンドが表面バンドに重なっているためと考えられる。2本のバンドの分裂幅については、K-J軸付近で計算の方が若干



Fig.19 Comparison of the experimental surface-state dispersion (shaded bands) for the Na/Si(001) 2×1 surface deduced from figs.14 and 16 with that (solid lines) of the theoretical calculation²⁷⁾ based on an optimized double-layer model (from ref.42).

大きいが、計算は実験結果を全体的に良く再現し ている。以上のように、今回の実験結果と理論計 算は、半定量的に一致すると言って差し支えない と思われる。この結果は、下地が対称ダイマー構 造をなし、K原子がPedestal site と Valley site に 吸着して2層吸着モデルを形成していることを支 持するものである。

図19に小林ら²⁷⁾による Na吸着 Si(001) 2×1表 面のバンド計算を実線で示す。先ほどと同様に、 ハーフトーンの帯で本研究のバンド分散の結果を 比較してある。計算のフェルミ準位の位置は、そ の分散が実験とよく合うように設定してある。バ ンドギャップの大きさがK吸着表面のものより大 きくなっているが、2×1-K表面と良く似た分散 が予想されている。計算では π ・と π に起因する2 本の表面準位が、バルクバンドギャップ中に現れ ているが、それぞれ実験で得られた S₁、S₁'の分散 と良く対応していることが分かる。したがって、 Na吸着 Si(001) 2×1表面の場合も、Na原子が、 対称ダイマー構造を形成した下地の Pedestal site と Valley site に吸着した 2 層吸着モデルが実現し ていると考えられる。そして,その 2 層吸着構造 の電子状態を支配しているのは,下地 Si ダイマー のダングリングボンド準位であることが分かる。

7. まとめ

Si(001)2×1-K, -Na飽和吸着表面の電子状 態をシンクロトロン放射光を使用した ARUPS に より調べた結果について報告した。実験は、下地 のSiダイマー列方向とダイマーボンド方向を明確 に区別するために、シングルドメイン構造の下地 を用いて行った。分散は、これまで未測定のJ-K -J'方向についても測定し、SBZ 内全ての対称軸 Γ-J-K-J'-Γに関する表面バンドの分散を得た。 高輝度で細く絞られた放射光の特徴を活かして、

SBZ内を高密度で調べることにより、これまで実 験的に1本と考えられていた表面準位が、2本のバ ンドであることを明らかにできた。また、放射光 の直線偏光性を利用して偏光依存 ARUPS を行 い、得られた表面準位の鏡映面に関する対称性を 得ることができた。K 飽和吸着表面と Na 飽和吸着 表面に対して得られた表面準位の分散は、お互い に良く似ており、対応する表面準位については同 じ対称性を持つことが分かった。このことは、両 表面で共通の構造モデルが予想されていることと 矛盾しない。フェルミ準位に最も近い2本の表面 準位に対して得られた対称性は、それらが下地 Si ダイマー表面のダングリングボンドの反結合状態 と結合状態に起源を持つ準位であることを示す有 力な証拠である。また, Si(001)2×1-K, -Na 飽和吸着表面で得られた表面準位の分散は、小林 ら27)の2層吸着モデルによる理論計算と反定量的 に一致した。

このように理論的な研究による支援もあり,ア ルカリ吸着 Si(001) 2×1表面の電子状態は,表面 の原子構造に基づいて理解できたと考えている。 今回得られた結果が,より複雑な系の解明に対す る糸口となることを期待したい。

謝辞

高エネルギー物理学研究所 PF における ARUPS 実験は、東北大理学部の柏倉隆之氏(現:宇都宮 大学),岡根哲夫氏,佐々木泰孝氏(現:東芝), 高橋秀行氏(現:NKK),遠田義晴博士(現:東 北大・通研),鈴木章二助教授,佐藤繁教授,東 大物性研の木下豊彦博士(現:分子研),柿崎明 人助教授,石井武比古教授,韓国成均館大学のS. W.Yu,K.A.Kang,C.Y.Park教授,電総研の坂本 邦博博士,坂本統徳博士との共同研究である。各 氏に感謝いたします。理論計算の結果を提供頂き ました無機材研の小林一昭博士,京都大学・工学 部の森川良忠博士,産業技術融合領域研究所の寺 倉清之教授に感謝致します。

文献

- M. C. Asensio, E. G. Michel, E. M. Oellig and R. Miranda, Appl. Phys. Lett. 51, 1714 (1987).
- J. E. Ortega, E. M. Oellig, J. Ferron and R. Miranda, Phys. Rev. B36, 6213 (1987).
- R. Miranda, "Physical and Chemical Aspects of alkali metal adsorption" Ed. H. P. Bonzel, A. Bradshow and G. Ertl, Elsevier, 1989.
- P. Soukiassian, T. M. Gentle, M. H. Bakshi and Z. Hurych, J. Appl. Phys. 60, 4339 (1986).
- A. U. MacRae, K. Muller, J. J. Lander, J. Morrison and J. C. Phillips, Phys. Rev. Lett. 22, 1048 (1969).
- 6) H. Tochihara, Surf. Sci. 126, 523 (1983).
- 7) 虻川匡司, 博士論文, 東北大学, 平成3年
- 8) B. Goldstein, Surf. Sci. 35, 227 (1973).
- 9) J. D. Levine, Surf. Sci. 35, 90 (1973).
- Joel A. Appelbaum, G. A. Baraff and D. R. Hamann, Phys. Rev. **B14**, 588 (1976).
- H. Tochihara and Y. Murata, J. Phys. Soc. Jpn. 51, 2920 (1982).
- T. Aruga, H. Tochihara and Y. Murata, Phys. Rev. Lett. 53, 372 (1984).
- M. Tsukaba, H. Ishida and N. Shima, Phys. Rev. Lett. 53, 376 (1984).
- H. Ishida, N. Shima and M. Tsukaba, Phys. Rev. B32, 6246 (1985).
- H. Ishida, N. Shima and M. Tsukaba, Surf. Sci. 158, 438 (1985).
- 16) S. Ciraci and I. P. Batra, Phys. Rev. Lett. 56, 877 (1986).
- 17) Y. Enta, S. Suzuki and S. Kono, Surf. Sci. 242, 277 (1991).
- 18) Y. Enta, T. Kinoshita, S. Suzuki and S. Kono, Phys.

Rev. **B36**, 9801 (1987).

- 19) Y. Enta, S. Suzuki and S. Kono, Phys. Rev. B39, 5524 (1989).
- 20) Y. Enta, T. Kinoshita, S. Suzuki and S. Kono, Phys. Rev. B39, 1125 (1989).
- 21) T. Abukawa and S. Kono, Phys. Rev. B37, 9097 (1988).
- 22) T. Abukawa and S. Kono, Surf. Sci. 214, 141 (1989).
- 23) M. Tsukada, N. Shima, Z. Zhu, H. Ishida and K. Terakura, in Proc. of the NATO Advanced Research Workshop on Metallization and Metal-Semiconductor Interfaces, Garching, 1988, edited by I. P. Batra, (Plenum, New York, 1988) 351.
- 24) H. Ishida and K. Terakura, Phys. Rev. B40, 11519 (1989).
- 25) I. P. Batra, Phys. Rev. B43, 12322 (1991).
- 26) Y. Morikawa, K. Kobayashi, K. Terakura and S. Blugel, Phys. Rev. **B44**, 3459 (1991).
- 27) K. Kobayashi, Y. Morikawa, K. Terakura and S. Blugel, Phys. Rev. B45, 3469 (1992).
- 28) 遠田義晴, 博士論文, 東北大学, 平成2年
- 29) L. S. O. Johansson and B. Reihl, Phys. Rev. Lett. 67, 2191 (1991).
- 30) L. S. O. Johansson and B. Reihl, Phys. Rev. B47, 1401 (1993).
- 31) 例えば, "Angle-resolved photoemission: theory and current applications", ed. S. D. Kevan, Elsevier, 1992.
- 32) B. Burns, in "Introduction to group theory with appli-

cations", Academic Press, Inc. New York, 1977.

- 33) J. Hermanson, Solid State Commun., 22, 9 (1977).
- 34) S. Suzuki, T. Kashiwakura, A. Kakizaki, T. Kinoshita, A. Harasawa, J. Fujii, S. Suga, M. Fujisawa, H. Kato, S. Sato and T. Ishii, Activity Report 1989 of Synchrotron Radiation Laboratory, Institute for Solid State Physics, p.60 (1990).
- 35) Kaplan, Surf. Sci. 93, 145 (1980).
- 36) T. Sakamoto and G. Hashiguchi, Jpn. J. Appl. Phys. 25, L78 (1986).
- T. Sakamoto, T. Kawamura and G. Hashiguchi, Appl. Phys. Lett. 48, 1612 (1986).
- 38) 坂本統徳,電子技術総合研究所,研究報告第875 (1986)
- 39) F. K. Meu. W. E. Packard and M. B. Webb, Phys. Rev. Lett. 61, 2469 (1988).
- 40) J. Pollmann, R. Kalla, P. Kruger, A. Mazur and G. Wolfgarten, Appl. Phys. A41, 21 (1986).
- 41) T. Abukawa, T. Kashiwakura, T. Okane, Y. Sasaki, H. Takahashi, Y. Enta, S. Suzuki, S. Kono, S. Sato, T. Kinoshita, A. Kakizaki, T. Ishii, C. Y. Park, S. W. Yu, K. Sakamoto and T. Sakamoto, Surf. Sci. 261, 217 (1992).
- 42) T. Abukawa, T. Kashiwakura, T. Okane, H. Takahashi, S. Suzuki, S. Kono, S. Sato, T. Kinoshita, A. Kakizaki, T. Ishii, C. Y. Park, K. A. Kang, K. Sakamoto and T. Sakamoto, Surf. Sci. 303, 146 (1994).

いわーど

角度分解紫外光電子分光法

角度分解光電子分光法(ARUPS)では、真空紫外光 h v を試料表面に入射し、電子を取り出す極角 θ 。、方 位角 ϕ の関数として光電子のエネルギー分光を行う。 つまり、放出された光電子の運動エネルギー E_{κ} と波数 ベクトル k'を同時に測定する。試料の仕事関数を Φ と すると、光電子の始状態の結合エネルギー E_{B} は、

 $E_{B} = hv - E_{K} - \Phi$

から求められる。励起の前後で、波数ベクトルの表面

に平行な成分についての保存則が成り立つので,始状 態の波数ベクトルの表面平行成分k₁は,

$$|\mathbf{k}_{\mathfrak{a}}| = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (hv - \mathbf{E}_{\mathsf{B}} - \Phi)} \cdot \sin\theta,$$

と表される。θ。と共に方位角φも変えれば、原理的に は表面ブリルアンゾーンの任意の点での結合エネル ギーE_Bを調べることができ、表面バンドの分散を求め ることができる。